## <sup>60</sup>Co-γ 선쪼임에 의한 출력MOSFET소자의 전기적특성변화연구

김신혁, 고병춘, 배성길

우주복사선환경과 원자로주변환경 등에서 쓰이는 전원회로의 출력MOSFET소자들에서 방사선쪼임에 의하여 나타나는 특성변화를 정확히 평가하고 그에 대한 대책을 세우는 것은 인공위성과 원자로의 운영믿음성을 보장하는데서 중요한 문제로 제기된다.[1-3]

론문에서는  $\gamma$  선쪼임에 의한 출력MOSFET소자들의 전기적특성변화를 측정평가하고 그 변화물림새를 설명함으로써 방사선환경에서 리용되는 이 소자들의 동작믿음성을 높이 기 위한 기초를 마련하였다.

#### 1. 출력MOSFET소자들에 대한 $\gamma$ 선쪼임

수직2중확산형구조로 생산리용되고있는 출력MOSFET소자에서 배출극은 소출력평면 형MOSFET소자와 달리 규소소편의 바닥면에 만들어진다. 조종극편의에 의해 열림상태로 될 때 이 소자에서는 원천극구역과 배출극구역사이 소자표면을 따라 p-n이음속에 짧고 넓은 전류통로가 형성된다. 이 통로로 흐르는 전류는 매우 빨리 선형구역에 도달한다. 이 소자는 또한 입구저항이 크고 절환속도가 빠르며 열적안정성과 믿음성도 높기때문에 전 원회로에서 출력조종에 많이 리용되고있다.

 ${
m nMOSFET}$ 소자들인 3단자 증가형소자  ${
m FZ44}($ 최대허용전압  $60{
m V},$  최대배출극전류  $50{
m A},$  출력  $150{
m W},$  통로저항  $28{
m m}\Omega$ 이하)와 5단자 증가형소자  ${
m BTS432}($ 최대허용전압  $63{
m V},$  최대배출극전류  $80{
m A},$  출력  $167{
m W},$  통로저항  $38{
m m}\Omega$ 이하)에  $\gamma$  선을 쪼임한 경우 조종극턱전압 (원천극접지조건에서 배출극전압  $10{
m V}$ 일 때 배출극전류  $1{
m m}{
m A}$ 를 보장하는 조종극전압)과

조종국-배출극전압전류특성변화를 고찰하 였다.

MOSFET소자들에 대한 γ 선포임은 복사세기는 0.012Gy/s인 <sup>60</sup>Co원천(에네르기 1.17, 1.33MeV, 평균에네르기 1.25MeV)을 리용하여진행하였다. 출력MOSFET소자들은 방온도에서편의가 없이 쪼임하였으며 약 1 500Gy까지의선량구간에서 일정한 선량간격으로 전기적특성을 측정평가하였다.

### 2. 측정결과 및 해석

출력nMOSFET소자들의  $\gamma$  선쪼임선량에 따르는 럭전압변화는 그림 1과 같다.

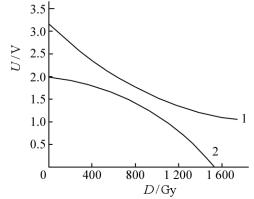


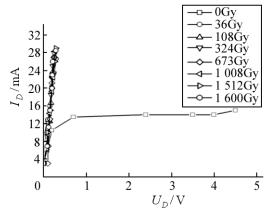
그림 1. 출력 ${
m nMOSFET}$ 소자들의  $\gamma$  선쪼임 선량에 따르는 턱전압변화 1-FZ44, 2-BTS432,  $U_{DS}$  =10V,  $I_{DS}$  = ${
m lmA}$ 

그림 1에서 보는바와 같이 약 1 600Gy의  $\gamma$  선쪼임을 받을 때 출력nMOSFET소자들의 럭전압이 선량에 따라 감소한다는것을 알수 있다. 특히 쪼임전에 3.15V의 럭전압을 가지는 BTS432소자는 1 000Gy의  $\gamma$  선쪼임을 받으면 1.2V이며 1 500Gy의  $\gamma$  선쪼임을 받으면 럭전압이 거의나 령으로 되면서 배출극전류에 대한 조종기능을 완전히 잃는다는것을 보여준다. 이것은  $\gamma$  선쪼임의 이온화효과에 의하여 출력소자의 조종극과 통로사이 산화물 충속에 형성된 양이온들의 기판전자들에 대한 꿀롱인력만으로도 배출극과 원천극사이의 전도통로를 충분히 형성하였기때문이다. 한편 FZ44의 조종극턱전압도 1 500Gy의 선량쪼임에 의하여 초기의 3.15V로부터 1.25V까지 충분히 감소(1.9V)하였다는것을 알수 있다.

MOSFET소자에서 정상상태일 때 원천극과 배출극사이의 전도통로는 조종극편의에 의하여 조성되거나 없어진다. 그러나 방사선쪼임을 받은 소자에서는 통로의 형성과 전도도에 조종극편의뿐아니라 SiO<sub>2</sub>층과 SiO<sub>2</sub>/Si경계에 존재하는 양이온들의 영향도 반영된다.

그러므로 방사선쪼임에 의하여 산화물과 산화물경계에 추가적인 양이온들이 존재하는 nMOSFET소자에서는 보다 작은 조종극편의가 걸려도 Si기판내부에 존재하는 전자들이 쉽게 조종극밑에 표류되여 원천극과 배출극사이의 전도통로를 형성하며 그 결과는 조종극턱전압의 감소로 나타난다.

조종극전압이 3.5V인 경우 FZ44와 BTS432의  $\gamma$  선쪼임선량에 따르는 배출극전압-전류특성변화는 그림 2,3과 같다.



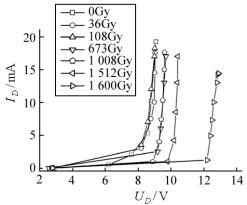


그림 2. 조종극전압이 3.5V인 경우 FZ44의  $\gamma$ 선 그림 3. 조종극전압이 3V인 경우 BTS432의  $\gamma$ 선 쪼임선량에 따르는 배출극전압 - 전류특성변화 쪼임선량에 따르는 배출극전압 - 전류특성변화

그림 2와 3에서 보는바와 같이 주어진 배출극전압에 대하여 출력소자들의 배출극전류가 방사선쪼임에 의하여 감소한다는것 즉 통로의 비저항이 증가한다는것을 알수 있다. 이것은 n통로형소자의 경우 조종극에 걸린 정의 편의전압에 비하여 산화물층속의 양이온들이 전도통로전자들에 더 가까이 존재하므로 꿀롱인력이 더 크기때문이다.

MOSFET소자에서 이러한 특성변화들이 나타나는것은 소자의 조종극밑에 존재하는 산화물과 산화물-반도체경계에서 방사선쪼임에 의해 생겨난 양전하들때문이다.

 $\gamma$  선쪼임은  $SiO_2$ 층에서 결정원자들에 대한 이온화효과에 의하여 구멍-전자쌍을 형성한다. 이때 형성된 구멍-전자쌍은 조종극에 걸리는 전기마당의 작용으로 서로 반대방향으로 이동하는데 이동도가 큰 전자(방온도이동도  $20 \text{cm}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$ )들은 빨리 빠져나가지만 구멍(방온도이동도  $1.6\cdot10^{-5} \text{cm}^2/(\text{V}\cdot\text{s})$ )들은 산화물속에 있는 여러 포획중심에 포획되여

양전하를 형성하게 된다. 이때 조종극에 정의 전압이 걸려있다면 구멍들은 SiO<sub>2</sub>/Si경계쪽으로 밀려가면서 산화물양전하를 더 증가시키며 반대로 조종극에 부의 전압이 걸려있으면 구멍들이 조종극쪽으로 표류되여 산화막밑에 밀집되게 된다.

이로부터 pMOSFET소자들은 일반적으로 nMOSFET소자들보다 이온화복사선에 대한 견딜성이 더 높다는것을 알수 있다.

#### 맺 는 말

- 1) γ 선쪼임선량에 따라 조종극턱전압은 감소하며 배출국-원천극통로의 비저항은 증가한다는것을 실험적으로 확인하였다.
- 2) 이온화방사선쪼임을 받은 출력MOSFET소자들에서 나타나는 전기적특성변화의 물 림새를 밝혔다.

#### 참 고 문 헌

- [1] Andrea Cester et al.; IEEE. Trans. Nucl. Sci., 51, 6, 3150, 2004.
- [2] 薛玉雄 等; 核电子学与探测技术, 28, 3, 538, 2008.
- [3] 刘刚 等; 辐射研究与辐射工艺学报, 24, 4, 201, 2006.

주체108(2019)년 12월 5일 원고접수

# The Change of Electrical Characteristics by $^{60}$ Co- $\gamma$ Ray Irradiation in Power MOSFET Demagnetisation

Kim Sin Hyok, Ko Pyong Chun and Pae Song Gil

We have experimentally confirmed that the gate threshold voltage decreases and the drain-source channel resistivity increases with  $\gamma$  ray irradiation dose. We have found the change mechanism of electrical characteristics in power MOSFET demagnetisation irradiated with a ionization radiation.

Keywords: MOSFET, drain-source